

# 深圳市三利谱光电科技股份有限公司

## 关于公司及子公司取得专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司莆田三利谱光电科技有限公司、深圳市三利谱光电技术有限公司、合肥三利谱光电科技有限公司于近日取得了由中华人民共和国国家知识产权局颁发的共计10项专利证书，具体情况如下：

**一、证书号：**第23491589号

**专利名称：**一种胶水过滤装置

**发明人：**孟海涛；张振东；庄飞；魏磊；李磊

**专利号：**ZL 2024 2 2892557.2

**专利类型：**实用新型专利证书

**专利申请日：**2024年11月26日

**专利权人：**合肥三利谱光电科技有限公司

**授权公告日：**2025年11月4日

**专利权期限：**本专利的专利权期限为十年，自申请日起算

本实用新型公开了一种胶水过滤装置，包括过滤罐和安装于过滤罐内的滤芯，所述过滤罐包括底座和安装于底座上的罐体，所述滤芯设置于罐体内部的底座上，所述罐体与滤芯之间的底座上设有进料通道，所述滤芯内部具有滤腔，所述滤腔下方的底座上还设有出料通道；所述罐体的顶部还安装有循环管，所述循环管上安装有第二截止阀，所述循环管与滤腔连通，本实用新型克服了现有技术的不足，实现了对结块胶水的过滤，保证了输出胶水的品质，从而提高了偏光片制造的良率。

**二、证书号：**第23498567号

**专利名称：**一种PSA的在线检测装置

**发明人：**马永胜;魏磊;闻庆波;陈剑

**专利号：**ZL 2024 2 2958615.7

**专利类型：**实用新型专利证书

**专利申请日：**2024年12月2日

**专利权人：**合肥三利谱光电科技有限公司

**授权公告日：**2025年11月4日

**专利权期限：**本专利的专利权期限为十年，自申请日起算

本实用新型公开了一种PSA的在线检测装置，包括设置于生产线上的检测器，所述检测器包括配合设置的相机、偏振镜、偏光片和光源，所述偏振镜设置于相机的正下方，偏振镜能够遮挡相机下方的视场，所述偏光片设置于光源的表面将光源朝向相机的一侧遮挡，偏振镜与偏光片对应设置，且偏振镜的吸收轴和偏光片的吸收轴正交设置，本实用新型克服了现有技术的不足，该检测装置能够有效地对PSA的缺陷进行检测。

**三、证书号：**第22955026号

**专利名称：**一种去盖板用偏光片

**发明人：**金宇翔;霍丙忠;郭奕强

**专利号：**ZL 2024 2 1906573.6

**专利类型：**实用新型专利证书

**专利申请日：**2024年8月8日

**专利权人：**深圳市三利谱光电技术有限公司

**授权公告日：**2025年6月13日

**专利权期限：**本专利的专利权期限为十年，自申请日起算

本实用新型公开了一种去盖板用偏光片，包括偏光片层、粘在偏光片层上表面的复合胶层、贴合在复合胶层上的TAC支撑层、涂布在TAC支撑层上的硬度涂液层、涂布在硬度涂液层上的AR涂层、涂布在AR涂层上的AF涂层、复合在AF涂层上的保护膜、粘在偏光片层下表面的压敏胶层和复合在压敏胶层下面的离型膜。本实用新型提供的去盖板用偏光片具有良好的硬度、抗刮和耐磨效果，并且具有薄化、轻量化和减少工序的优点。

**四、证书号：**第23225993号

**专利名称：**一种尼龙偏光眼镜用染料系偏光片

**发明人：**郭晓峰;张建军;唐万林;张艺玲;丘宝模

**专利号：**ZL 2024 2 2410154. X

**专利类型：**实用新型专利证书

**专利申请日：**2024年10月1日

**专利权人：**莆田三利谱光电科技有限公司

**授权公告日：**2025年8月19日

**专利权期限：**本专利的专利权期限为十年，自申请日起算

本实用新型公开一种尼龙偏光眼镜用染料系偏光片，包括从上到下依次叠放的离型膜、亚克力胶层、上TAC层、PVA层和下TAC层；亚克力胶层具有如下性质：

1、亚克力胶层的酸值小于0.05；2、亚克力胶层的TG温度为-20℃到-8℃；3、亚克力胶层的厚度为5-25um；4、亚克力胶层的凝胶分率大于75%。本实用新型尼龙偏光眼镜用染料系偏光片不用UV胶，不用PA光学级薄膜，同时能有效地和PA树脂进行铸塑成型，不会在界面处分层脱落，工艺简单。

**五、证书号：**第7723232号

**专利名称：**一种调节组件及导辊机构

**发明人：**芦山;卢阳;康家虎;张建军;芦婷;魏友芳

**专利号：**ZL 2021 1 0340273. 0

**专利类型：**发明专利证书

**专利申请日：**2021年3月30日

**专利权人：**深圳市三利谱光电科技股份有限公司

**授权公告日：**2025年2月11日

**专利权期限：**本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算

本专利是为设备导辊位置精度的调整提供方便，以便卷料产品走膜稳定，减少划伤，皱褶，偏膜等不稳定因素的产生，促进产品良率提升。

**六、证书号：**第8522085号

**专利名称：**一种新风装置、排气方法及清洁设备

**发明人：**孙娟;李涤非;赵星星

**专利号：**ZL 2023 1 0333957. 7

**专利类型：**发明专利证书

**专利申请日：**2023年3月31日

**专利权人：**深圳市三利谱光电科技股份有限公司

**授权公告日：**2025年11月28日

**专利权期限：**本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算

本发明属于光学镜片加工技术领域，公开了一种新风装置、排气方法及清洁设备。新风装置用于将设备内的废气排出车间，包括：进风组件、循环组件以及排风组件。进风组件与设备连通以持续向所述设备内吹风；循环组件分别与设备及进风组件连通，以将设备内的一部分废气通过进风组件循环导入设备内，以增大设备内的废气浓度；排风组件分别与循环组件及车间外连通，排风组件用于将循环组件内另一部分废气排出所述车间。以此该新风装置将设备内较高浓度的废气排出车间，实现在短时间内排出更多的废气，以提高新风装置运行时能源的利用率，同时也能够提高对废气的回收效率，进而降低废气处理的成本。

**七、证书号：**第23514456号

**专利名称：**一种聚PA染料系偏光片

**发明人：**张建军;郭晓峰;张艺玲;唐万林;丘宝模

**专利号：**ZL 2024 2 2358981.9

**专利类型：**实用新型专利证书

**专利申请日：**2024年9月26日

**专利权人：**深圳市三利谱光电科技股份有限公司

**授权公告日：**2025年11月7日

**专利权期限：**本专利的专利权期限为十年，自申请日起算

本实用新型公开一种聚PA染料系偏光片，包括从上到下依次叠放的上PA层、PVA层以及下PA层；上PA层和PVA层之间以及PVA层和下PA层之间采用UV粘合剂粘接。本实用新型聚PA染料系偏光片耐弯折，耐高温泡水且不出现彩虹纹。

**八、证书号：**第23572736号

**专利名称：**偏光片、眼镜片、显示器

**发明人：**张建军;郭晓峰;丘宝模

**专利号：**ZL 2024 2 2471568.3

**专利类型：**实用新型专利证书

**专利申请日：**2024年10月11日

**专利权人：**深圳市三利谱光电科技股份有限公司

**授权公告日：**2025年11月25日

**专利权期限：**本专利的专利权期限为十年，自申请日起算

本申请涉及光学器件技术领域，尤其涉及偏光片、眼镜片、显示器。偏光片包括第一聚碳酸酯层、聚乙烯醇层、第二聚碳酸酯层，第一聚碳酸酯层、聚乙烯醇层、第二聚碳酸酯层依次层叠形成三明治结构。本申请偏光片创造性地将偏光片的结构设计为聚碳酸酯层-聚乙烯醇层-聚碳酸酯层的三明治结构，其中，聚乙烯醇层起到偏振的作用，两个聚碳酸酯层作为偏光片的基材，具有相应的光学透过率等性能，还兼顾支撑与保护聚乙烯醇层。相比现有的聚碳酸酯-三醋酸纤维素-聚乙烯醇-三醋酸纤维素的偏光片，本申请偏光片极大降低了生产成本，在裁切时不易分层，没有彩虹纹或彩虹纹轻微，稳定性更高。可以用于眼镜片、抬头显示、LCD显示中。

**九、证书号：**第8590216号

**专利名称：**一种偏光片加工设备

**发明人：**曾朝升；张建军；阮志毅；张汉平；陈恒；王泽塔；彭连启

**专利号：**ZL 2020 1 1348433.8

**专利类型：**发明专利证书

**专利申请日：**2020年11月26日

**专利权人：**深圳市三利谱光电科技股份有限公司

**授权公告日：**2025年12月19日

**专利权期限：**本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算

本申请提供了一种偏光片加工设备。本申请提供的偏光片加工设备包括：卷料上卷机构，用于向自动放卷机构输送偏光片卷料；自动放卷机构，用于接收卷料上卷机构输送的偏光片卷料并将偏光片卷料输送至激光切割机构；激光切割机构，包括多个激光切割头，激光切割头用于切割偏光片卷料以获得偏光片；自动吸移机构，包括吸盘，吸盘用于吸附偏光片并将偏光片送移至喷码机构；喷码机构，包括多个喷码头，喷码头用于向偏光片喷码。本申请提供的偏光片加工设备，

以激光切割机构实现切割偏光片卷料，进而获得单个偏光片，取消了现有液压裁切机、刀模、小裁切机及磨边机等，偏光片加工设备的结构和工序得到简化，同时降低了投入成本，提高了产品的质量。

**十、证书号：**第8596525号

**专利名称：**一种光学模拟方法、装置、设备和介质

**发明人：**陈思博;陈方中;霍丙忠;黄盆盛;张建军

**专利号：**ZL 2023 1 0578190.4

**专利类型：**发明专利证书

**专利申请日：**2023年5月22日

**专利权人：**深圳市三利谱光电科技股份有限公司

**授权公告日：**2025年12月23日

**专利权期限：**本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算

本发明公开了一种光学模拟方法、装置、设备和介质，其中方法包括：通过朗道理论获取液晶层的平衡态模型；基于平衡态模型获取液晶层的琼斯矩阵表示；分别获取显示面板中的各偏光片、各补偿膜、入射光的琼斯矩阵表示；根据前述琼斯矩阵表示获取出射光的琼斯矩阵表示；根据出射光和入射光的琼斯矩阵表示计算显示面板的透过率表示；根据透过率表示，调整各偏光片的参数和/或各补偿膜的参数，以使透过率在入射光不同的入射角度下达到与液晶层匹配的预期透过率。从而，可以模拟出各个状态下的显示面板，并可以根据预期透过率调整偏光片的参数和/或补偿膜的参数，对实际中偏光片和补偿膜的搭配选择起到了指导性的作用。提升了选择的效率。

以上发明专利应用于偏光片领域，已在公司生产中应用或即将应用，与公司主要技术或核心技术直接相关。专利的取得不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但有利于公司保护自主知识产权，防止侵权事件发生，掌握市场竞争主动权，形成持续自主创新机制和能力，保持技术和产品的领先和竞争优势，提高公司品牌和市场影响力，进一步提升公司的核心竞争力。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2025年12月31日